研究スタッフ

教授:	高橋 研、	准教授:	角田 匡	清
准教授:	斉藤 伸、	助 教:	小川 智	之
技官:	小野寺 政信			
研究員:	金 東栄、石棉	喬 信一、 絲	者方 安伸	•
	Haitao Yang、	長谷川 大	二、磯上	慎二

研究目的

本研究室では、化学合成を中心としたウェットプロセスならびにスパッタ法を中心としたドライプロセスを駆使することによって、超高密度磁気記録媒体、高性能・高感度を有するMRAM・SVヘッドおよび高周波デバイスを実現し得る、新たな材料設計・プロセス技術の確立を目指している。



高橋研究室

www.takahashi.ecei.tohoku.ac.jp



高橋研究室

www.takahashi.ecei.tohoku.ac.jp